

SIMULASI SUIS OPTIK MENGGUNAKAN TEKNOLOGI MEMs

MOHAMAD NAZIB BIN ADON

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

SIMULASI SUIS OPTIK MENGGUNAKAN TEKNOLOGI MEMs

MOHAMAD NAZIB BIN ADON

Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian
daripada syarat penganugerahan
Ijazah Sarjana Kejuruteraan Elektrik (Elektronik dan Telekomunikasi)

Fakulti Kejuruteraan Elektrik
Universiti Teknologi Malaysia

MEI, 2006

Syukur kepada ALLAH
Umi, Nadhirah, Najihah
keluarga Spg Lima dan KK
pensyarah
sahabat - sahabat
terima kasih di atas sokongan dan pengorbanan

PENGHARGAAN

Allahuakbar Allahuakbar Allahuakbar segala puji bagi Allah tuhan sekalian alam. Syukur di atas nikmat yang telah dilimpahkan sesungguhnya tiada tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad S.A.W yang telah membawa cahaya keislaman untuk kemakmuran dan kesejahteraan umat sejagat.

Terima kasih tidak terhingga diucapkan kepada Umi, Nadhirah dan Najihah di atas pengorbananmu selama ini. Buat keluarga Simpang Lima dan Kuala Kangsar terima kasih di atas dorongan dan galakan yang telah diberikan.

Seterusnya rakaman penghargaan ini saya tujuhan kepada penyelia projek, Prof. Madya Dr. Norazan Mohd Kassim di atas bimbingan, nasihat dan bantuan beliau dalam menjayakan projek ini.

Ucapan terima kasih juga kepada En. Ahmad Hassan, En. Leow Cheah Wei dan En. Hanif Ibrahim yang merupakan kumpulan penyelidik photonik UTM di atas tunjuk ajar dan kemudahan yang telah disediakan.

ABSTRACT

MEMs or known as MicroElectromechanical System is first introduced in 1980s. This technology is a combination of sensors, mechanical and electronic elements. All of them are unite in single basic material (silicon) and fabricated using a micro-fabrication system. Two micro fabrication techniques are normally used, a bulk micro-machining and surfaced micro-machining technique. The latter technique is preferred due to advanced fabrication technique and its ability to construct complex mechanical structures. In this project, a CoventorWare™ software that is based on surfaced micro-machining technique is applied. In order to obtain an optimum design, a basic two dimensional (2D) design is done to identify the actual width, length and thickness of the MEMs device. The 2D design is then converted to three dimensional (3D) design where a boundary condition analysis is done. Four types of meshing analysis are adopted in CoventorWare™ which are surfaces, tetrahedron, Manhattan brick and extruded. The meshing analysis selection is based on simulation period together with the level of analysis correctness. In order to identify the existence of any capacitance and pressure effects on the developed design, the electrostatic and electromechanical analyses are carried out. Finally, analyses on the combined solutions of electrostatic and electromechanical analyses are done for the active device application.

ABSTRAK

MEMs atau lebih dikenali sebagai sistem *Microelectromechanical* mula diperkenalkan pada tahun 1980an. Teknologi ini menggabungkan elemen pengesan, penggerak dan elektronik. Kesemua elemen ini disatukan dalam satu bahan asas (*silicon*) dan menjalani proses fabrikasi-mikro. Dua teknik pemesinan-mikro yang selalu digunakan ialah pemesinan-mikro pukal dan pemesinan-mikro permukaan. Perisian CoventorWareTM menggunakan teknik pemesinan-mikro permukaan kerana teknik fabrikasinya lebih maju dan struktur mekanikal yang kompleks boleh dibina. Secara asasnya teknik ini dibina dengan mewujudkan beberapa lapisan bahan yang kemudiannya ada lapisan dihapuskan dan selebihnya akan menjadi struktur bahan. Hasil daripada pemilihan bahan dan proses pemesinan-mikro permukaan yang tepat rekabentuk 2D boleh dilakukan. Pada peringkat ini usuran lebar, panjang dan tebal peranti perlu dikenalpasti untuk mendapatkan rekabentuk yang optimum. Setelah itu rekabentuk 2D dipindahkan kebentuk 3D, dimana analisis syarat sempadan dilaksanakan. CoventorWareTM menggunakan empat jenis analisis jejaring iaitu permukaan, tetrahedron, bata manhattan dan bata melempar (*extruded*). Pemilihan analisis jejaring adalah berdasarkan kepada ketepatan analisis yang berkadar terus dengan tempoh masa simulasi. Setelah itu analisis elektrostatik dan analisis elekmekanikal dijalankan untuk mengenalpasti adanya kesan kemuatan dan kesan tekanan terhadap rekabentuk yang dibina. Akhir sekali analisis penyelesaian gandingan (gabungan analisis elektrostatik dan elektromekanikal) dibuat untuk melihat kebolehpercayaan yang tinggi terhadap peranti aktif.

KANDUNGAN

| BAB | PERKARA | MUKA SURAT |
|---------------|------------------------------------|-------------------|
| | JUDUL | i |
| | PENGAKUAN | ii |
| | DEDIKASI | iii |
| | PENGHARGAAN | iv |
| | ABSTRAK | v |
| | ABSTRACT | vi |
| | KANDUNGAN | vii |
| | SENARAI JADUAL | x |
| | SENARAI RAJAH | xi |
| BAB I | PENGENALAN | |
| | 1.1 Pengenalan | 1 |
| | 1.2 Kenyataan Masalah | 3 |
| | 1.3 Objektif Projek | 3 |
| | 1.4 Skop Projek | 4 |
| | 1.5 Metodologi Penyelidikan | 5 |
| BAB II | TEKNOLOGI MEMS DALAM SUIS | |
| | OPTIK | |
| | 2.1 Pengenalan | 8 |
| | 2.2 Teknologi MEMs | 9 |
| | 2.3 Kelebihan MEMs | 10 |
| | 2.4 Fabrikasi Pemesinan Mikro | 11 |
| | 2.4.1 Teknik Pemesinan-Mikro Pukal | 11 |
| | 2.4.2 Teknik Pemesinan-Mikro | |
| | Permukaan | 13 |

| | | |
|----------------|---|----|
| | 2.4.3 Teknik Pemesinan-Mikro LIGA | 14 |
| 2.5 | Struktur Asas | 16 |
| 2.6 | Aplikasi MEMs | 18 |
| BAB III | REKABENTUK RASUK JULUR | |
| 3.1 | Pengenalan | 20 |
| 3.2 | Rekabentuk Rujukan | 20 |
| 3.3 | Model Matematik Rasuk Julur | 21 |
| 3.4 | Rekabentuk Menggunakan Coventorware | 24 |
| 3.4.1 | Spesifikasi Bahan | 24 |
| 3.4.2 | Proses Pemesinan Mikro | 25 |
| 3.4.3 | Rekabentuk 2D | 27 |
| 3.4.4 | Rekabentuk 3D | 28 |
| 3.4.5 | Analisis Coventorware | 31 |
| BAB IV | KEPUTUSAN COVENTORWARE™ | |
| 4.1 | Pengenalan | 39 |
| 4.2 | Struktur Tanpa Bahan Logam | 39 |
| 4.3 | Struktur Dengan Bahan Logam | 41 |
| 4.4 | Analisis CosolveEM Voltan Bekalan 10volt | 42 |
| 4.5 | Analisis CosolveEM Mengambilkira proses lelaran 20volt | 44 |
| BAB V | ANALISIS DATA | |
| 5.1 | Pengenalan | 48 |
| 5.2 | Perbandingan Model | 48 |
| BAB VI | KESIMPULAN DAN CADANGAN | |
| | PENAMBAHBAIKAN | |
| 6.1 | Pengenalan | 52 |
| 6.2 | Cadangan Penambahbaikan | 53 |

RUJUKAN

55

LAMPIRAN

57

SENARAI JADUAL

| NO | TAJUK | MUKA SURAT |
|-----------|---|-----------------------|
| 2.1 | Bahan berdasarkan silikon berbanding aluminium dan keluli | 9 |
| 2.2 | Perbandingan MEMs dengan teknik lain | 10 |
| 2.3 | Parameter rekabentuk rujukan | 17 |
| 2.4 | Ciri – cirri peranti suis optik teknologi MEMs | 19 |
| 5.1 | Perbandingan nilai anjakan voltan tarik – ke dalam | 50 |

SENARAI RAJAH

| NO | TAJUK | MUKA SURAT |
|-----------|--|-----------------------|
| 1.1 | Proses membina peranti suis optik | 5 |
| 1.2 | Proses rekabentuk menggunakan Coventorware | 7 |
| 2.1 | Gabungan teknologi Optik, Elektrik dan Mekanikal | 9 |
| 2.2 | Punaran isotropi dan tidak isotropi | 12 |
| 2.3 | Proses POLYMUMPS | 14 |
| 2.4 | Langkah proses LIGA | 15 |
| 2.5 | Rekabentuk rujukan bagi rasuk jujukan | 16 |
| 2.6 | Contoh 2x2 peranti suis optik teknologi MEMs | 18 |
| 3.1 | Dimensi rekabentuk rujukan | 21 |
| 3.2 | Rekabentuk lengkung rasuk julur separa | 22 |
| 3.3 | Graf pesongan rasuk julur melawan voltan | 23 |
| 3.4 | Spesifikasi bahan | 25 |
| 3.5 | Proses piawai polymumps | 26 |
| 3.6 | Saiz grid yang digunakan | 27 |
| 3.7 | Paparan 2D | 28 |
| 3.8 | Jejaring <i>surface</i> | 29 |
| 3.9 | Jejaring <i>Manhattan</i> | 30 |
| 3.10 | Paparan 3D | 30 |
| 3.11 | Analisis struktur MEMs | 31 |
| 3.12 | Paparan MemElectro | 33 |
| 3.13 | Paparan MemMech | 34 |
| 3.14 | Paparan MemMech BCs | 35 |

| | | |
|------|--|----|
| 3.15 | Paparan pilihan <i>surfaceBCs</i> | 36 |
| 3.16 | Paparan CosolveEM | 37 |
| 3.17 | Paparan CosolveEM BCs bersama sub-menu pilihan | 38 |
| 4.1 | Nilai anjakan rasuk julur | 40 |
| 4.2 | Nilai anjakan rasuk julur | 41 |
| 4.3 | Nilai kemuatan struktur | 42 |
| 4.4 | Nilai anjakan rasuk julur | 42 |
| 4.5 | Nilai voltan dan cas | 43 |
| 4.6 | Nilai <i>residual force</i> | 43 |
| 4.7 | Paparan 3D | 44 |
| 4.8 | Kesan kenaikan voltan terhadap kemuatan | 45 |
| 4.9 | Kesan kenaikan voltan terhadap rasuk jujukan | 46 |
| 4.10 | Graf anjakan rasuk julur melawan voltan | 47 |
| 5.1 | Graf perbandingan model matematik dan Coventorware | 49 |
| 5.2 | Graf anjakan Coventorware | 49 |

BAB I

PENGENALAN

1.1 Pengenalan

Bab ini meliputi latar belakang projek, kenyataan masalah, objektif projek, skop projek dan metodologi projek. Latarbelakang projek akan diuraikan dengan lebih teliti dalam Bab1. Projek ini kebanyakannya berkaitan dengan peranti suis optik.

Perkembangan sistem komunikasi seluruh dunia berkembang dengan pesatnya. Tambahan pula dengan kemodenan teknologi ICT yang membawa kita kepada ledakan maklumat yang begitu hebat. Walaupun teknologi yang digunakan sekarang begitu canggih ia sebenarnya terbentuk dari beberapa komponen dan peranti – peranti untuk memastikan segala proses penghantaran berjalan dengan lancar. Salah satu sistem penghantaran maklumat adalah melalui gentian optik. Penghantaran maklumat melalui gentian optik mempunyai satu sistem yang tersusun melibatkan peranti dan komponen-komponen optik. Diantara peranti dan komponen-komponen optik yang digunakan adalah seperti laser, kabel gentian optik, pemisah, pengesan fotodiod, pemultipleks optik, suis optik, sambung silang dan lain-lain.

Oleh yang demikian, dalam memperincikan lagi perlakuan serta ciri-ciri peranti yang terdapat di dalam sistem perhubungan optik maka saya memilih untuk mengkaji dengan lebih teliti salah satu peranti yang digunakan iaitu suis optik. Peranti suis optik dipilih adalah berdasarkan kepada keperluan dan perkembangan teknologinya yang semakin meningkat. Sejajar dengan itu suis optik juga menjadi bidang penyelidikan utama di pusat penyelidikan photonik dan universiti sehingga ada kemudahan bilik bersih untuk melakukan proses fabrikasi peranti terbabit.

Suis optik diperkenalkan adalah untuk menggantikan penggunaan suis konvensional. Sebelum suis optik diperkenalkan isyarat optik terpaksa ditukar kepada isyarat elektronik dan kemudian ditukar semula kepada optik (OEO) ketika pensuisan. Setelah suis optik diperkenalkan maka isyarat optik bebas bergerak diantara satu peranti ke peranti yang lain (OOO) tanpa perlu ditukar kepada isyarat elektronik. Keperluan kepada penggunaan suis optik ini adalah sangat penting, memandangkan pada masa sekarang rangkaian optik boleh membawa ratusan panjang gelombang dengan kadar kelajuan penghantaran 10Gbit/saat. Terdapat juga beberapa pengeluar menawarkan kadar kelajuan sistem 40Gbit/saat dan 80Gbit/saat berbanding dengan suis elektronik yang kurang cekap apabila beroperasi pada kelajuan melebihi 40Gbit/saat.

Oleh yang demikian penyelidikan yang berterusan telah dijalankan dalam membina suis optik berdasarkan kriteria bahan yang digunakan, kelajuan dan daya tahan suis tersebut. Salah satu teknologi terkini yang digunakan untuk membina suis optik adalah teknologi MEMs. Peningkatan pasaran teknologi MEMs di seluruh dunia adalah meningkat termasuklah penggunaannya di dalam biomedik, aeroangkasa, automobil dan lain – lain. Menurut jangkaan EmTech Research (www.techonline.com) pasaran teknologi MEMs akan meningkat dari USD 6.5 billion pada tahun 2004 kepada USD 11 billion pada 2009. Berdasarkan faktor ini membuktikan keperluan kepada pengetahuan dan penyelidikan yang mendalam terhadap teknologi MEMs adalah penting, khususnya dalam pembangunan peranti suis optik.

1.2 Kenyataan Masalah

Rekabentuk suis optik menggunakan teknologi MEMs boleh dilakukan melalui kaedah berangka (*numerical*) atau menggunakan aplikasi perisian yang sedia ada. Dalam penyelidikan ini saya menggunakan kedua – dua kaedah, manakala perisian Coventorware2004/2005 digunakan untuk merekabentuk dan menganalisa peranti suis optik. Sungguhpun begitu terdapat beberapa masalah yang perlu dirungkaikan diantaranya:-

- (i) Memastikan kaedah MEMs yang sesuai untuk suis optik.
- (ii) Memahami jenis bahan yang digunakan.
- (iii) Memahami teori tentang operasi penggerak (*cantilever*) suis optik MEMs.
- (iv) Memahami kaedah penggunaan CoventorWare2004/2005.
- (v) Merekabentuk suis optik menggunakan teknologi MEMs.

1.3 Objektif Projek

Berdasarkan kenyataan masalah pada bahagian 1.2, maka objektif projek mestilah berkaitan dengan permasalahan tersebut. Kriteria objektif mestilah boleh diselesaikan dalam tempoh masa projek dijalankan dan mencapai kepada matlamat akhir projek ini iaitu berkemampuan merekabentuk dan menganalisa suis optik menggunakan teknologi MEMs melalui simulasi CoventorWare2004/2005. Bagi merungkaikan permasalahan tersebut, objektif penyelidikan perlulah jelas diantaranya:-

- (i) Memahami konsep teknologi MEMs dalam aplikasi telekomunikasi.
- (ii) Berkeupayaan untuk merekabentuk dan menganalisis rasuk julur.
- (iii) Rekabentuk suis optik berdasarkan teknologi MEMs.
- (iv) Berkebolehan menggunakan CoventorWare sebagai perisian simulasi.

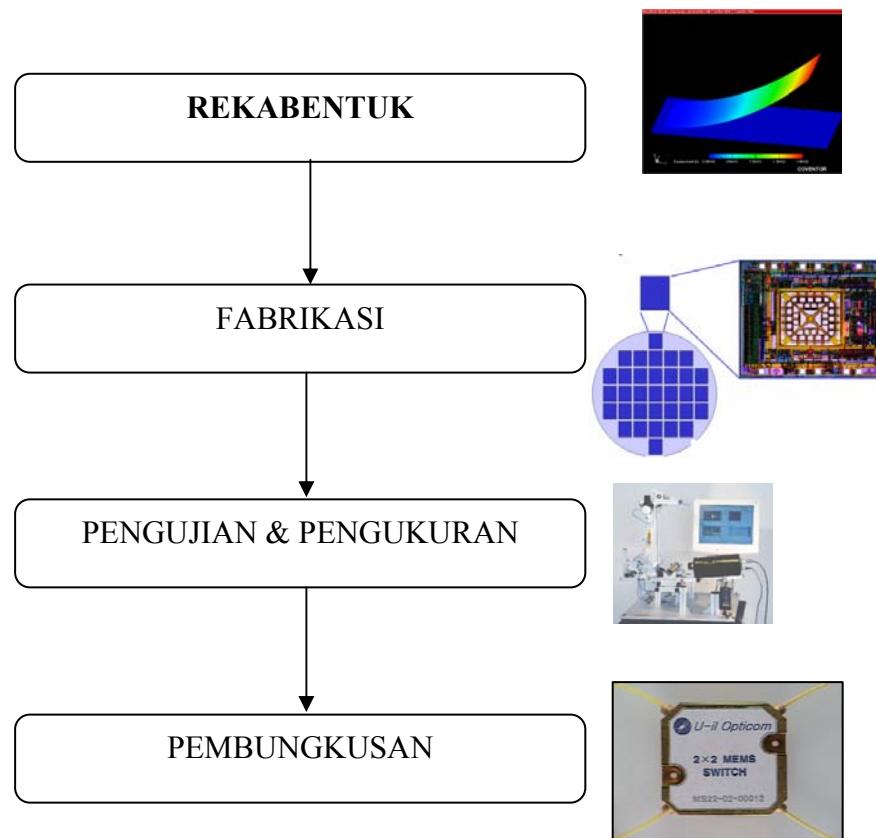
1.4 Skop Projek

Bagi memastikan penyelidikan yang dijalankan mempunyai kajian ilmiah, skop penyelidikan perlulah merangkumi perkara yang ingin dicapai di dalam penyelidikan. Dalam merekabentuk suis optik yang optimum beberapa parameter perlulah dikaji antaranya saiz suis (panjang, lebar, tebal), jenis bahan (silikon, polimer, emas, dan lain-lain) yang digunakan, voltan yang dikenakan dan kesan anjakan rasuk. Secara keseluruhannya skop penyelidikan perlulah meliputi :-

- (i) Memahami rekabentuk suis yang dibina.
- (ii) Memahami pergerakan daya elektrostatik.
- (iii) Memahirkan penggunaan perisian CoventorWare™.
- (iv) Melakukan proses rekabentuk dan menganalisis parameter yang ingin dikaji melalui simulası.
- (v) Memahami konsep asas rekabentuk optik bersepadu.

1.5 Metodologi Penyelidikan

Secara keseluruhannya proses membina peranti suis optik boleh dibahagikan kepada 4 bahagian seperti yang ditunjukkan di dalam Rajah 1 di bawah. Peringkat pertama adalah rekabentuk suis optik diikuti fabrikasi, pengujian, pengukuran dan akhir sekali peringkat pembungkusan. Cadangan penyelidikan ini hanyalah melibatkan peringkat rekabentuk yang menggunakan perisian ConventorWare 2004/2005.

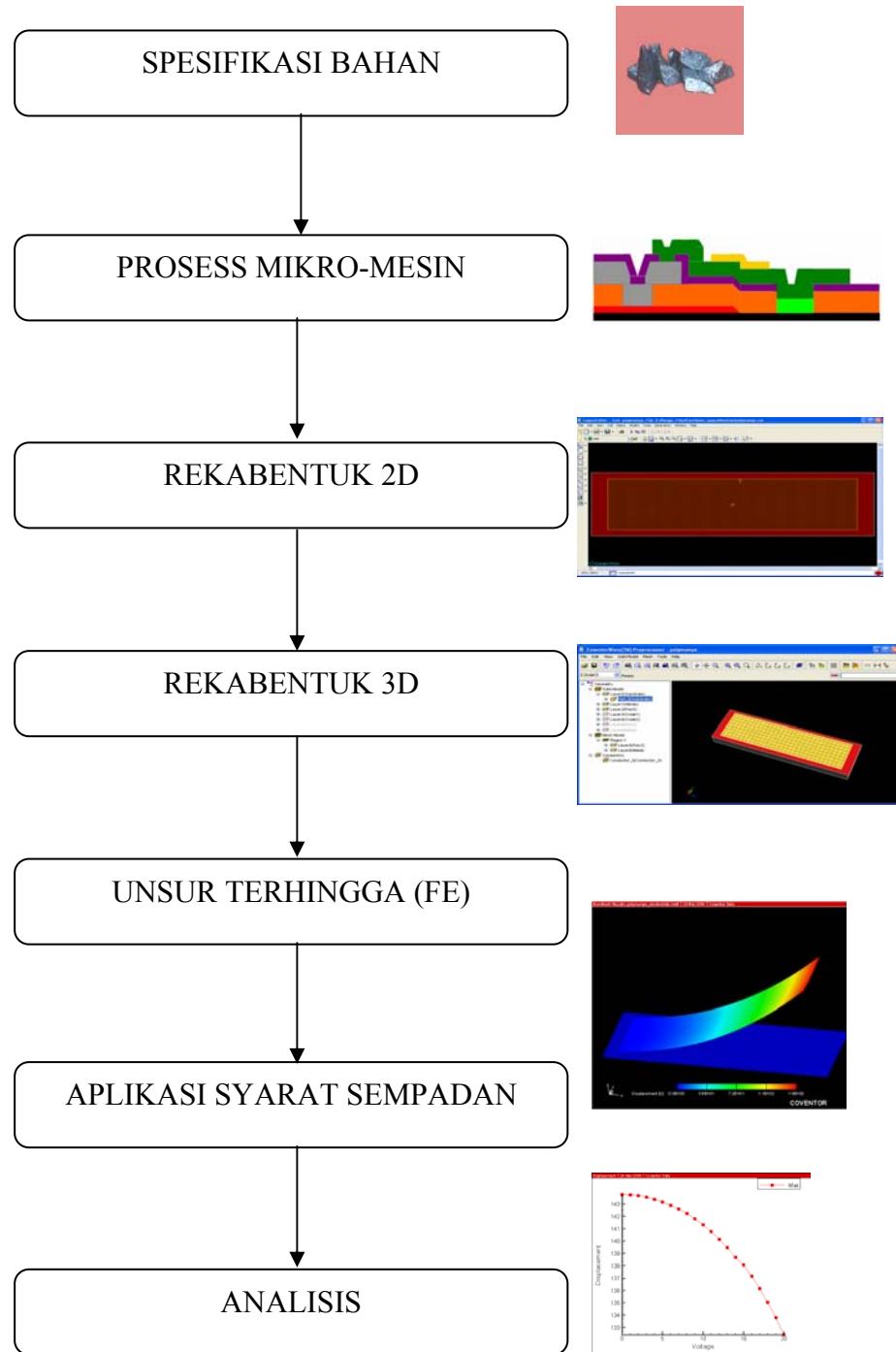


Rajah 1.1 Proses membina peranti suis optik

Dalam merekabentuk suis optik menggunakan teknologi MEMs terdapat dua bahagian yang perlu diberi perhatian iaitu bahagian penggerak (*actuator*) dan bahagian unit transduser yang mana membekalkan voltan kepada penggerak menyebabkan daya kilas berlaku pada suis tersebut. Disamping itu dalam merekabentuk suis optik MEMs CoventorWare 2004 menggariskan beberapa kriteria perlu dilalui antaranya mengenalpasti spesifikasi bahan yang hendak digunakan (polimer, silikon, emas dll), proses pemilihan rekabentuk, paparan rekabentuk dibuat dalam bentuk 2D dan 3D, analisis menggunakan kaedah unsur terhingga, mengambilkira syarat sempadan antara bahan yang digunakan, menganalisis parameter dari segi voltan dan ajakan pergerakan penggerak.

Secara keseluruhannya penyelidikan ini menggunakan perisian CoventorWare 2004/2005 untuk merekabentuk suis optik MEMs, rajah 2 menunjukkan langkah – langkah proses merekabentuk teknologi MEMs menggunakan CoventorWare.

Oleh yang demikian pembacaan dan pengetahuan yang diperolehi adalah menjurus kepada mendalami penggunaan perisian ini.



Rajah 1.2 Proses rekabentuk menggunakan CoventorWare